

微奈米結構製作用壓印膠

技術特色

壓印技術製作蝕刻遮罩 (etching mask) 取代光阻微影製程具有設備投資成本低、製程簡化優點，同時對應未來基板尺寸變大與圖案精細化的趨勢，藍寶石基板翹曲可能造成微影製程良率的降低，壓印製程相對具有競爭優勢。

技術規格

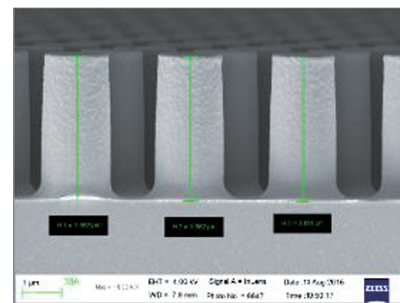
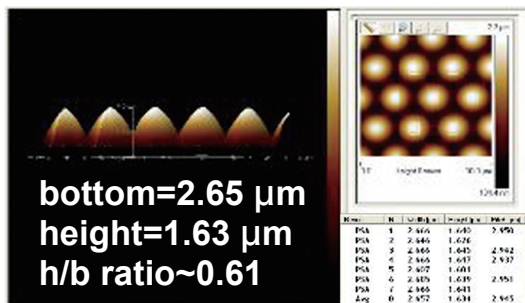
壓印膠	MCL-PSS	Germany	Japan
壓印製程	Thermal-UV NIL	Thermal-UV NIL	UV NIL
Film type	Solid film	Solid film	Liquid film
壓印溫度	≥70 °C	≥70 °C	R. T.
壓印壓力	5 bar	5 bar	~0
塗膜安定性	>15 hr	>15 hr	< 3 hr
蝕刻選擇比	>0.7	~0.55	~ 0.7

產業應用

在圖案化藍寶石基板 (PSS/Patterned Sapphire Substrate) 應用中，製作微、奈米結構可提升LED發光效率，尤其在micro LED的NPSS結構更具競爭力。



4吋圖案畫藍寶石晶片



高深寬比、低殘餘層結構壓印

